

# 窒化珪素(Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)パウダー

## 窒化ホウ素(BN)焼結体

### 窒化珪素(Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)パウダー

#### 特 徴

- α型のみならずβ型のラインナップ有
- 取扱い品種が豊富**
- カスタマイズが可能

#### 用 途

- 窒化珪素基板**
- 放熱フィラー**
- 窒化珪素焼結体

結晶構造	α			β	
	グレード名	CX-R08H	CX-R05	CX-R03	CX-H01
粒子径	0.6-0.8μm	1.2μm	1.5μm	3.4μm	2.8μm
酸素量	1.0%	2.0%	1.5%	1.0%	3.5%
Fe (ppm)	300	2000	200	10	8000



### 窒化ホウ素(BN)焼結体

#### 特 徴

- 短納期での対応が可能 (1.5ヶ月)**
- AlN基板焼成用のグレード有
- BN複合材の取扱い有
- 小口～量産対応も可能**

#### 用 途

- 窒化珪素基板焼成用セッター**
- 非酸化物焼成用セッター
- 窒化アルミ基板焼成用セッター**
- 各種絶縁部品

	BN99	BN99.7
純 度	≥99%	≥99.7%
密 度	2.0g/cm <sup>3</sup>	1.6g/cm <sup>3</sup>
サイズ	400x300mm	400x300mm

詳細は別紙カタログを御確認ください。

